

ナノインプリント技術 2006 徹底検証

主催：電子ジャーナル

日時：7月25日（火）9:35～18:00

会場：コクヨホール

nmレベルの3次元加工を簡単な原理で低コストに生産できる技術としてナノインプリント技術への注目が急速に高まっています。FPD用をはじめとする光学デバイスなどで、その実用化も一部始まりましたが、記録媒体、Si半導体、電子デバイス、バイオ・化学チップ関連など、幅広い応用分野への適用が期待されています。その一方、量産技術としての加工・安定性に多くの課題を残しており、装置・モールド・被転写樹脂・離形剤やプロセス開発など、異分野・異業種を巻き込んだトータルでの取り組みにより、これらの課題を総合的に解決しようとする動きも本格化しつつあります。応用分野を中心に、ナノインプリント技術の最前線を徹底検証します。

【プログラム】

総論 ナノインプリント技術

【09:35～11:35】 ナノインプリント技術の現状と将来展望

ナノインプリント技術のインパクト

ナノインプリント技術の各種方式

ナノインプリント技術の要素技術

ナノインプリント技術の応用

大阪府立大学大学院 工学研究科 電子・数物系専攻 教授 平井義彦氏

ナノインプリント技術の応用展開

【11:40～12:20】 記録媒体への応用事例 ナノホール垂直パターンドメディア

(株)山形富士通 菊地英幸氏

(昼食)

【13:05～13:45】 記録媒体への応用事例

(株)Ovonic 相変化研究所 太田威夫氏

【13:45～14:25】 光学デバイスへの応用事例

オムロン(株) 技術本部 先端デバイス研究所 コア技術グループ 主事 伊藤嘉則氏

【14:25～15:05】 分析用デバイスへの応用事例

(株)日立製作所 日立研究所 材料研究所 電子材料研究部

ナノプリントストラテジックソリューション ユニットリーダー 宮内昭浩氏

(休憩)

【15:15～15:55】 半導体リソグラフィへの応用

モレキュラー・インプリント・インク

アプリケーションズ・エンジニアリング・マネージャー 和田英之氏

ナノインプリント装置・部材の最前線

【15:55～16:35】 微細転写におけるナノインプリント技術の可能性

東芝機械(株) 微細転写事業部 微細転写技術部長 福山 聡氏

(休憩)

- 【16：40～17：20】 ロールナノインプリント技術による大面積化
ナノクラフトテクノロジーズ株式会社 取締役 後藤博史氏
- 【17：20～18：00】 「3-DEF」によるロール電鍍ナノインプリント金型
若狭電機産業(株) コンサルティングマネージャ 清水利寛氏